# 含氮氟化类金刚石(FN-DLC)薄膜的 研究(Ⅲ)疏水性能分析

肖剑荣<sup>1,2</sup><sup>+</sup> 徐 慧<sup>1</sup>) 邓超生<sup>2</sup>) 王焕友<sup>2</sup>) 李燕峰<sup>1</sup>)

1)(中南大学物理科学与技术学院,长沙 410083)

2)(中南大学材料科学与工程学院,长沙 410083)

(2006年10月11日收到2006年12月7日收到修改稿)

不同沉积条件下,在单晶硅基底上沉积了含氮氟化类金刚石(FN-DLC)薄膜,用静滴接触角/表面张力测量仪测量了水与FN-DLC 膜表面的接触角.用 X 射线光电子能谱、Raman 光谱和傅里叶变换吸收红外光谱(FTIR)分析了薄膜的组分和结构.用原子力显微镜观测了薄膜的表面形貌.结果表明,FN-DLC 薄膜疏水性能主要取决于薄膜表面的化学结构、薄膜表面极化强度的强弱、以及薄膜的表面粗糙度的大小.sp<sup>3</sup>/sp<sup>2</sup> 的比值减小,CF<sub>2</sub> 基团含量增加,薄膜粗糙度增加,接触角增大;反之,则接触角减小.在工艺上,沉积温度和功率的减小,气体流量比r(r = CF4/[CF4 + CH4])的增加,都会使水的浸润性变差,接触角增大.

关键词:氟化类金刚石膜,疏水性,接触角 PACC:8115H,6810C

# 1.引 言

类金刚石(DLC) 膜是一种非晶碳膜,具有许多 类似于金刚石的优良性能,如高硬度、低摩擦系数、 高耐磨、导热、电绝缘、透光以及良好的化学稳定性 和生物相容性等,能广泛应用于机械、电子、化学、 军事、航空航天、生物医学等领域,长期以来一直受 到研究者的青睐<sup>11</sup>.含氮氟化类金刚石薄膜(FN-DLC) 是基于传统类金刚石膜的基础上发展起来的 一种改性材料,该膜具有许多比金刚石薄膜更为优 越的性能,近年来引起了人们的极大关注<sup>[23]</sup>.对于 FN-DLC 薄膜的研究 以前研究者大多把注意力集中 在其电学和光学性质上、或是其性质与结构和工艺 的关系上探讨,也得到了很多有益的结论2-4].但 是 对 FN-DLC 薄膜有望在医学领域得到应用的其 他特性(如疏水性、生物相容性等)的研究就很少涉 及.在疏水性能方面,FN-DLC和聚四氟乙烯(PTFE) 很相似,有 C-F.(x=1,2,3)基团, 而现在 PTFE 已经 成功应用于临床医疗领域,但是在特定情况下(如心 管支架,外科手术刀等),由于 PTFE 的机械性能较

差、与基体结合不牢固,限制了其广泛的应用<sup>[5-7]</sup>. FN-DLC薄膜由于具有良好的与基体黏附性、优异的 生物相容性、抗细菌黏附、良好的机械性能、低的表 面能、高的疏水性能,已经成为研究的一个新热 点<sup>[8-10]</sup>,有望取代 PTFE 成为新一代生物改性材料, 表现出非常诱人的开发应用前景.

研究不同沉积条件下制备 FN-DLC 薄膜的结构 与疏水性能,以及它们之间的内在关系,对于 FN-DLC 能否真正应用于临床医疗有重要的参考价值. 但是国内外有关该方面的报道却很少,本文对不同 沉积条件下制备的 FN-DLC 膜结构与疏水性能进行 了研究,进一步探讨了薄膜结构及制备工艺对疏水 性能的影响.

## 2. 实 验

本文实验设备在文献[11]已做了详细介绍.采 用 CH<sub>4</sub>, CF<sub>4</sub>和 N<sub>2</sub>为源气体, Ar 为工作气体, 气体的 总流量为 50 seem, N<sub>2</sub>和 Ar 分别保持在 8 seem 和 2 seem不变,不同实验条件下,改变气体流量比r(r= CF<sub>4</sub>/[CH<sub>4</sub> + CF<sub>4</sub>]),沉积气压在 5.5 Pa 左右.基片

<sup>†</sup> E-mail :csu\_ xiaojianrong@yahoo.com.cn

采用单晶硅(100)面,基片依次浸泡在丙酮、酒精和 去离子水中用超声波清洗 10 min,除去表面的有机 污染和天然氧化层.清洗后,立即用烘箱烘干,放入 真空室中 尽量减少尘埃污染.实验中,沉积功率 *P* 在 100 W—300 W 之间选取,沉积温度 *T* 在室温至 200℃之间选取,室温时,基片没有加热,但由于粒子 的轰击,基片温度会达到 50℃左右.每次实验本底 压强不低于 1.0×10<sup>-3</sup> Pa,沉积前,在 Ar 环境中先用 100 W 的功率轰击基片表面 10 min,进一步清洁其 表面.

薄膜表面组分用 Microlab 310-F 型 X 射线光电 子能谱(XPS)仪测量;用 Dilor LabRam-INFINITY 型 Raman 光谱仪测试了不同流量比下样品的散射光 谱;用 NEXUS470 型傅里叶变换红外光谱(FTIR)仪 对薄膜的化学键结构进行了分析;用 JC2000C3 型静 滴接触角/表面张力测量仪测量薄膜的接触角;利用 SOLVER P47 型多模式扫描探针显微镜(AFM)观察不同流量比下薄膜形貌的变化.

## 3. 实验结果与讨论

### 3.1. 接触角的测量

固体被水浸润的难易程度是固体疏水性能优劣的体现,而接触角大小是疏水性能优劣的表征,接触角的大小由物质表面的物理性质决定的.图1显示了水在 DLC 和两个不同条件下制备的 FN-DLC 样品表面的接触角,其值分别为 61.3°,82.2°和 97.6°.可见,在 DLC 膜中掺 F 后,接触角显著增大,这说明其疏水性能有了明显的改善.并且不同条件下制备的FN-DLC 薄膜,由于其内部组分、结构和表面特性的不同,它的疏水性也发生了明显变化.



图 1 不同样品表面形成的接触角 (a)DLC (b)FN-DLQ 150 W 200℃, r = 0.75) (c)FN-DLQ 100 W,100℃, r = 0.75)

当液体与固体互相接触时,附着层中的液体分子,受到液体内部的作用力(内聚力)和受到固体分子的作用力(附着力),因此液体能否很好地浸润固体,则根据内聚力和附着力的大小来决定.从表面能的角度考虑,它由固液两相界面自由能高低来决定,界面自由能越高,固体越难被浸润.水是极性分子液体,极化强度较大.所以,对于被浸润的固体,极化强度越大,就越容易被浸润,反之,则越难被浸润.对于FN-DLC薄膜,由于F的掺入,使之含有极性较强的C-CF和C-F亲水基团和极性较弱的CF2 疏水基团,只要能合理调制膜中亲、疏水基团的含量,可获得所需特性的FN-DLC 膜.

## 3.2. 沉积温度对接触角的影响

不同沉积温度 T 下沉积的 FN-DLC 薄膜的 FTIR 谱,如图 2 所示.可见,由于沉积温度改变,薄膜的红 外谱线发生了明显变化 随着沉积温度的升高,曲线 变得平坦.在 1160 cm<sup>-1</sup>,1450 cm<sup>-1</sup>和 1718 cm<sup>-1</sup>处分 别对应 CF<sub>2</sub> 对称伸缩峰、CF<sub>2</sub> 不对称伸缩峰和 CF<sub>2</sub> —C伸缩峰明显减弱<sup>121</sup> 这说明 CF<sub>2</sub> 基团含量减



图 2 不同温度下薄膜的 FTIR 谱(波数 600—1800 cm<sup>-1</sup>)

少.在 980 cm<sup>-1</sup>处的 CF<sub>3</sub> 伸缩峰比较弱,说明薄膜中 CF<sub>3</sub> 基团含量较低.薄膜中 CF<sub>2</sub>,CF<sub>3</sub> 基团含量的减 少,说明薄膜内 F 的含量随着沉积温度的增加而降 低.而在 1580—1620 cm<sup>-1</sup>处对应 C — C 伸缩峰的相 对含量变化较小,这说明膜内 C — C 受温度的影响 不大,相对比较稳定.在 1200 cm<sup>-1</sup>附近,主要对应 C-F<sub>x</sub>(x = 1,2,3)键<sup>[13]</sup>,该处由于峰间的强烈耦合,很 难指出由于温度的变化引起哪一个峰加强或哪一个 峰减弱,要了解各峰具体强弱的变化,只有用高斯拟 合的办法.但我们可以通过薄膜的红外吸收带,应用 Beer 公式<sup>[14,15]</sup>获得薄膜内F原子的相对浓度

$$n_x = A \int \frac{\alpha(\omega)}{\omega} d\omega$$

其中  $n_x$  为 x 原子的浓度 ,A 为常数 , $a(\omega)$ 是在频率 为  $\omega$  时的吸收系数.这样我们得到 FN-DLC 薄膜与 水接触角随沉积温度及膜内 F 含量相对浓度的变 化 ,如表 1 所示.可见,接触角随沉积温度的增加 ,先 略有增加后减小.我们分析可能是在适当的温度下 (100℃左右)有利于 F 与 C 结合成膜 ,因此 ,在温度 开始升高时薄膜内 F 的浓度增加 ,此时 CF<sub>2</sub> 基团的 相对含量也随之增加 ,而 CF<sub>2</sub> 基团极性较弱 极化强 度较小 ,当含量增加时 ,FN-DLC 薄膜表面的极性减 弱 则与水的浸润性变差 ,接触角变大.当沉积温度 继续升高时 ,薄膜内部分 F 以 HF 的形式从膜内逸 出 ,导致薄膜内 F 的含量降低 ,CF<sub>2</sub> 基团的含量也随 着减少 ,接触角变小.

表1 沉积温度 下的相对浓度与接触角大小

温度/℃	50	100	150	200	
F相对浓度	0.21	0.24	0.18	0.13	
接触角 <i>(</i> (°)	95.2	97.6	89.1	82.2	
ļ	其他条件 P = 150 W		r = 0.75		

## 3.3. 流量比对接触角的影响

图 3 是不同气体流量比 r 下 FN-DLC 薄膜的 Roman 光谱 ,图中显示两个散射峰 ,1355 cm<sup>-1</sup>处的 D 峰和 1575 cm<sup>-1</sup>处的 G 峰 ,D 峰是膜内 sp<sup>3</sup> 结构的体 现 ,G 峰膜内 sp<sup>2</sup> 结构的体现 .我们知道 ,sp<sup>3</sup> 结构中 的四个价电子形成  $\sigma$  键 ,而 sp<sup>2</sup> 结构中的三个价电



图 3 不同气体流量比 r 下 FN-DLC 薄膜的 Roman 光谱

子形成  $\sigma$ , 第四个价电子形成  $\pi$  键  $\pi$  键是一个弱键. 这两个峰的出现说明该膜是由 sp<sup>2</sup> 和 sp<sup>3</sup> 结构组成 的包含 $\sigma$ 键和 $\pi$ 键的混合网络.随着流量比的增加, 膜内 F 的含量增加<sup>[16,17]</sup>,氟元素的引入使得 D 峰及 G峰的强度比  $I_{\rm p}/I_{\rm c}$  逐渐增加 ,G 峰宽度变窄 ,而峰 的强度比  $I_{\rm p}/I_{\rm c}$  与 sp<sup>3</sup>/sp<sup>2</sup> 的比值成反比关系<sup>[18]</sup>,即 峰的强度比  $I_{\rm p}/I_{\rm c}$  逐渐加强 ,G 峰变窄意味着  ${\rm sp}^3/$ sp<sup>2</sup> 的比值减小,可见氟掺杂导致薄膜中的 sp<sup>3</sup> 杂化 金刚石键的含量相对减少 ,而 sp<sup>2</sup> 杂化石墨的含量 相对增加.当碳氟原子之间形成—CF, —CF, 键时, 链状或线性的— $CF_{x}(x = 2,3)$ 键将会破坏薄膜的三 维网状交联结构 薄膜从典型的三维类金刚石状交 联结构向二维聚合物状结构转变<sup>19]</sup>,极性减弱,极 化强度减小.众多研究结果表明 随着流量比 r 的增 加 薄膜内 F 的含量增加 ,介电常数减小<sup>[16,18]</sup>.由于 极化强度  $P = k_{\chi}E$ ,可知极化强度 P 与介电常数 k成正比关系.因此,随着流量比的增加,薄膜的极化 强度减小.

FN-DLC 薄膜与水的接触角随气体流量比的变 化以及与 *I*<sub>D</sub>/*I*<sub>c</sub> 的关系,如表 2 所示,可见,接触角 很大程度上依赖气流比r的变化.在流量比0—0.75 范围内,接触角随流量比的增大而增大,而介电常数 随气流比的增大而减小,极化强度也减小,则不易被 水浸润,接触角变大.但是当流量比大于0.75时,接 触角随流量比的增大有所降低,这是由于此时薄膜 表面的粗糙度增加,使得薄膜易于被水浸润,具体见 下文分析.

表 2 流量比  $r_{,I_{D}}/I_{G}$  与接触角大小

流量比 r	0.10	0.33	0.75	1.0
$I_{\rm D}/I_{\rm G}$	3.38	4.71	5.65	6.30
接触角 <i>(</i> ° )	84.7	88.1	95.4	94.2
其他条件 P = 150 W			$T = 100 ^{\circ}\mathrm{C}$	

#### 3.4. 沉积功率对接触角的影响

对不同功率下沉积的 FN-DLC 薄膜的 XPS 谱见 图 4,我们对其 C1s 峰进行了高斯拟合. C1s 峰解叠 为了 3 个峰,它们是<sup>20 21 1</sup>287 eV 289 eV 292 eV ;分别 对应 C—CF, C—F, CF<sub>2</sub>.把各拟合峰面积进行归一化 计算,三键的组分比例是 C—CF: C—F: CF<sub>2</sub> = 0.4812 :0.4140:0.0385. 由此可见, CF, C—CF 是薄膜主要 键组成,而 CF<sub>2</sub> 键基团在薄膜中含量相对较少.当沉 积功率增加时,膜内 F 的浓度降低,薄膜氟化程度降 低, CF和 CF<sub>2</sub>基团则减少, C—CF基团相对增加.沉



图 4 不同功率下沉积的 FN-DLC 薄膜 XPS 的 C1s 谱峰

表 3 沉积功率 ,CF2 相对浓度与接触角大小

功率/W	100	150	200	300
CF2 浓度	0.23	0.21	0.18	0.12
接触角 <i>(</i> (°)	101.3	97.6	90.8	85.0
其他条件 T = 100℃		r = 0.75		

积功率、薄膜内 CF<sub>2</sub> 键基团的相对含量与接触角的 变化关系如表 3 所示.可见,沉积功率的增大,薄膜 易被水浸润,接触角变小.这是由于薄膜内强极性基 团 C—CF 的含量相对增加,弱极性基团 CF<sub>2</sub> 的含量 相对减少,即膜内亲水基团 C—CF 的含量增加,疏



水基团 CF, 的含量减少,导致接触角减小.

#### 3.5. 表面粗糙度对接触角的影响

荷叶效应的机理是因为荷叶表面细胞形态具有 微/纳米双重尺度的乳突结构 在其表面微结构中包 含有疏水蜡质体[2].因此,从仿生学的角度来说,通 过构建出特有的微/纳米复合结构,也就是调制薄膜 表面的粗糙度,有利于改善薄膜的疏水性.图5是不 同气体流量比下制备的 FN-DLC 薄膜样品在 2 µm × 2 µm 范围内 AFM 表面形貌图.可见,在较低流量比 下制备的薄膜都比较致密 ,由非晶颗粒堆积团簇而 成 但是随着氟含量增大时 非晶颗粒大小出现不均 匀 薄膜有较多凹凸以及缺陷.首先 随着流量比的 增加,薄膜的颗粒度先略微减小,再明显增大,当, 为 0.10 时 FN-DLC 薄膜颗较均匀 粒径平均尺寸为 在 40 nm 左右. 当流量比 r = 0.33 时, 薄膜颗粒大小 很均匀,颗粒尺寸约为 60 nm 左右. 当 r = 0.75 时, 薄膜颗粒尺寸继续增大,颗粒大小又趋向不均,总的 来说 在 r=0.1-0.75 之间 随着 r 的增大 薄膜颗 粒逐渐增大,粗糙度增加,与水的接触角也随着变 大.但当流量比 r = 1.0 时 薄膜质量急剧下降 出现 严重的凹凸不平 颗粒变大而且很不均匀 粗糙度也 明显变大,在所观察范围内,薄膜的表面粗糙度由



2.057 nm(*r* = 0.33)增加至 7.180 nm(*r* = 1.0),且薄 膜的最高峰由 18.14 nm(*r* = 0.33)增大到 43.25 nm (*r* = 1.0).这是由于流量比很大时,F原子的浓度很 高 对表面的刻蚀作用很强<sup>[23]</sup>,使得薄膜表面的粗 糙度增大,薄膜表面明显出现较多的凹凸不平和缺 陷 粗糙度增大,接触角反而比*r* = 0.75 时要小.

## 4.结 论

FN-DLC 薄膜疏水性能主要取决于薄膜表面的

化学结构、薄膜表面极化强度的强弱、以及薄膜的表面粗糙度的大小.

1.F 含量的增加 ,sp<sup>2</sup> 含量增加 ,薄膜极化强度 减小 ,与水的浸润性变差 ,接触角增大.

3. 弱极化基团 CF<sub>2</sub> 含量增加 ,薄膜极化强度降低 ,或薄膜表面粗糙度增大 ,接触角增大.

3. 在工艺上,沉积温度、功率减小,或气体流量 比增加,都不利于水的浸润,接触角增大.

感谢中南大学材料科学与工程学院余志明教授的指导.

- [1] Robertson J 2002 Mat. Sci. Eng. R 37 129
- [2] Jiang M F, Ning Z Y 2004 Acta Phys. Sin. 53 3220 (in Chinese)
  [江美福、宁兆元 2004 物理学报 53 3220]
- [3] Ye C, Ning Z Y, Cheng S H, Yu X 2004 Diamond Reatl. Mater. 13 191
- [4] Jiang M F , Ning Z Y 2006 Surf. Coat. Techonl. 200 3682
- [5] Mclaughlin J A, Meenan B, Maguire P et al 1996 Diamond Reat. Mater. 5 486
- [6] Butter R S , Waterman D R , Lettington A H et al 1997 Thin Solid Films 311 107
- [7] Donnet C 1998 Surf. Coat. Technol. 100-101 180
- [8] Hakovita M ,Verda R , He X M et al 2001 Diamand Relat. Mater. 10 1486
- [9] Hauert R ,Muller U ,Francz G et al 1997 Thin Solid Films 308-309 191
- [10] Bray D J, Venkatraman C, Outten C A et al 2002 U. S. Patent 468 64
- [11] Liu X F, Xiao J R, Jian X Z et al 2004 Trans. Nonferrous Met. Soc. China. 14 426

- [12] Marra DC, Aydil E S 1997 J. Vac. Sci. Technol. A 15 2508
- [13] Jeong W Y, Young H L, Bakhtier F 2003 Thin Solid Films 423 97
- [14] Xin Y, Ning Z Y, Ye Z et al 2003 Surf. Coat. Techonl. 173 172
- [15] Liu S, Gangopadhyay S, Sreenivas G et al 1997 Phys. Rev. B 55 13020
- [16] Yokomichi H , Masuda A 1999 J. Appl. Phys. 86 2468
- [17] Valentini L , Braca E , Kenny J M et al 2002 Diamond Relat. Mater. 11 1100
- [18] Jung H , Park H 2002 Thin Solid Films 420-421 248
- [19] Yao Z Q, Sun P, Wang J et al 2005 J. Inorg. Mater. 20 731 (in Chinese)[姚志强、孙 萍、王 进等 2005 无机材料学报 20 731]
- [20] Freire J F L , Maiada C M E H , Jacobsohn L G et al 2001 Diamond Relat . Mater. 10 125
- [21] Valentini L , Braca E , Kenny J M et al 2001 Mater . Lett . 51 514
- [22] Ball P 1999 Nature 400 507
- [23] Xin Y, Ning Z Y, Gan Z Q, Lu X H 2001 Acta Phys. Sin. 50 2492 (in Chinese) [辛 煜、宁兆元、甘肇强、陆新华 2001 物理 学报 50 2492]

# Study on FN-DLC thin films ( III ) hydrophobic nature analysis

Xiao Jian-Rong<sup>1,2,)†</sup> Xu Hui<sup>1</sup>) Deng Chao-Sheng<sup>2</sup>) Wang Huan-You<sup>2</sup>) Li Yan-Feng<sup>1</sup>)

1) School of Physics Science and Technology, Central South University, Changshua 410083, China)

2) School of Material Science and Engineering, Central South University, Changsha 410083, China)

(Received 11 October 2006; revised manuscript received 7 December 2006)

#### Abstract

Nitrogen doping of fluorinated diamond-like carbon (FN-DLC) films were deposited on p-type (100) silicon wafers at different deposition condition. The contact angle of water on the FN-DLC films surfaces was measured by a sessile-drop method. The surface morphology of films was characterized by atomic force microscopy (AFM). The Raman spectrum , infrared spectrum and X-ray photoelectron spectrum (XPS) demonstrate that the hydrophobic nature of FN-DLC films lies on chemistry structure , polarization intensity and roughness of films surface. As the ratio of  $sp^3/sp^2$  decreases , the quantity of CF<sub>2</sub> and roughness of film surface increases , thus contact angle increases. Otherwise , contact angle decreases. The contact angle is correlated with the deposition condition , which low temperature , low radio frequency power and high flux ratio  $r(r = CF_4/L CF_4 + CH_4 ])$  brings the contact angle to ascend.

Keywords : fluorinated diamond-like carbon films , hydrophobic nature , contact angle PACC : 8115H , 6810C

<sup>3003</sup> 

<sup>†</sup> E-mail: csu\_ xiaojianrong@yahoo.com.cn